

# Panier De Nettoyage Humide En Ptfé Haute Pureté, Porte-Gravure Monoplage Personnalisable Pour Masque 4 Pouces

Numéro d'article: PL-CP66



## Introduction

Les paniers de nettoyage humide en PTFE haute pureté offrent une résistance chimique exceptionnelle pour le traitement des plaquettes semi-conductrices. Ces portes-gravure personnalisables garantissent un nettoyage par immersion et une manipulation sans contamination pour les substrats délicats dans des environnements de laboratoire et industriels exigeants. Contactez-nous pour des solutions sur mesure en polymère fluoré.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage Clé
Nettoyage de Plaquettes Semi-conductrices	Immersion des plaquettes de silicium dans les séquences de nettoyage RCA (SC-1 et SC-2) pour éliminer les contaminants organiques et métalliques.	Empêche la contamination croisée et garantit un traitement de haute pureté.
Gravure Chimique Humide	Gravure de précision des couches minces (SiO <sub>2</sub> , Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> ) à l'aide de bains d'acide fluorhydrique ou phosphorique à températures élevées.	Maintient l'intégrité structurelle dans des environnements acides agressifs.
Traitement des Plaques Masques	Manipulation et nettoyage spécialisés des photomasques utilisés en lithographie pour garantir un transfert de motif sans défaut.	Les fentes de précision préviennent les dommages par contact sur la surface du masque.
Fabrication de Cellules Solaires	Traitement en vrac des plaquettes de silicium pour la texturation et l'élimination du verre de silicate de phosphore (PSG).	Débit élevé et durabilité dans les cycles de production à grand volume.
Préparation du Verre Conducteur	Nettoyage et préparation du verre revêtu d'ITO/FTO pour la fabrication d'optoélectronique et d'écrans.	Des points de contact minimaux préviennent les rayures des couches conductrices délicates.
Développement MEMS	Manipulation des systèmes micro-électromécaniques multicouches pendant les processus complexes de gravure des couches sacrificielles.	L'inertie chimique garantit que les microstructures délicates ne sont pas compromises.
R&D à l'Échelle Laboratoire	Traitement de substrats en petits lots pour la recherche académique et industrielle dans le développement de nouveaux matériaux.	La personnalisation polyvalente permet des formes et tailles de substrats non standard.

Paramètre	Détails des Spécifications (Modèle : PL-CP66)
Composition du Matériau	PTFE Vierge Haute Pureté 100% (Polytétrafluoroéthylène)
Température de Fonctionnement Maximale	+260°C (Continue)
Température de Fonctionnement Minimale	-200°C
Compatibilité Chimique	Universelle (pH 0-14) ; Résistant à HF, Eau Régale, Solution Piranha
Taille de Substrat Standard	4 pouces (100mm) - Personnalisable pour tous diamètres
Configuration des Fentes	Variante monoplage ou multi-plaquettes disponibles
Profondeur/Largeur de Fente	Entièrement personnalisable selon l'épaisseur du substrat et les besoins de stabilité
Conception de la Poignée	Poignées verticales fixes, amovibles ou à bascule (Personnalisable)

Application	Description	Avantage Clé
Paramètre	Détails des Spécifications (Modèle : PL-CP66)	
Méthode de Fabrication	Usinage CNC de Précision (Zéro Contamination de Moulage)	
Finition de Surface	Finition usinée à haute lissé et faible porosité	